

OFM
Opaque Fused Materials
 Der Standard für
 neue Anwendungen

Heraeus Quarzglas

Säuren / Acids	
<input type="radio"/> H ₂ SO ₄	
<input type="radio"/> HNO ₃	
<input type="radio"/> HCl	
<input checked="" type="radio"/> HF	jedoch träger als mit normalem Glas
<input checked="" type="radio"/> H ₃ PO ₄	jedoch träger als mit normalem Glas
<input type="radio"/> Organische Säuren	
Gase und Dämpfe / Gases and Vapors	
<input type="radio"/> HCl	
<input type="radio"/> H ₂ ; N ₂ ; O ₂	
<input type="radio"/> NO ₂ ; SO ₂	
<input type="radio"/> CO	
Oxyde / Oxides	
<input checked="" type="radio"/> Al ₂ O ₃	nur über 1.200 °C
<input checked="" type="radio"/> BaO	nur über 900 °C
<input checked="" type="radio"/> CaO	nur über 1.000 °C
<input checked="" type="radio"/> CuO	nur über 950 °C
<input checked="" type="radio"/> Fe-Oxyde	nur über 950 °C
<input checked="" type="radio"/> MgO	nur über 950 °C
<input checked="" type="radio"/> PbO	
<input checked="" type="radio"/> ZnO	nur über 800 °C
<input checked="" type="radio"/> Basische Oxyde	nur über 800 °C Beschleunigung der Entglasung
Salze	
<input checked="" type="radio"/> BaCl ₂	
<input checked="" type="radio"/> BaSO ₄	nur über 700 °C
<input checked="" type="radio"/> Borate	
<input checked="" type="radio"/> BCl ₃	nur über 900 °C
<input checked="" type="radio"/> KCl	unterstützt Entglasung
<input checked="" type="radio"/> KF	
<input checked="" type="radio"/> NaCl	
<input checked="" type="radio"/> Na-Metaphosphat	
<input checked="" type="radio"/> Na-Polyphosphat	
<input type="radio"/> Na ₂ SO ₄	
<input checked="" type="radio"/> Na-Tungstat	unterstützt Entglasung
<input checked="" type="radio"/> Nitrate	
<input checked="" type="radio"/> Pt- Ammoniumchlorid	nur über 900 °C
<input checked="" type="radio"/> ZnCl ₂	
<input checked="" type="radio"/> Zn-Phosphat	leicht bei 200 °C erheblich bei 1.000 °C
<input checked="" type="radio"/> Zn-Silicat	nur über 1.000 °C



OFM 70 Flansch
Da x Di: 300 x 250 (mm)



OFM 70 Flansch
Da x Di x L: 500 x 460 x 500 (mm)



OFM 70 Glocke
D x W x H: 1000 x 20 x 2200 (mm)



OFM 370 Tiegel
D x W x H: 400 x 10 x 600 (mm)



OFM 370 Tiegel
D x W x H: 500 x 15 x 800 (mm)



OFM 970 Platte
L x B x D: 400 x 200 x 20 (mm)



OFM 970 Platte
D x W: 200 x 20 (mm)



OFM 970 Flansch
Da x Di: 180 x 140 (mm)



OFM 970 Flansch
Da x Di x L: 340 x 300 x 100 (mm)



OFM 970 Rohr
Da x W x L: 240 x 6 x 300 (mm)



OFM 970 Rohr
Da x W x L: 270 x 6 x 500 (mm)



OFM 970 Rohr
Da x W x L: 180 x 20 x 6100 (mm)

Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG
 Division Industrial Technologies
 Postfach 15 54
 63450 Hanau, Germany

Telefon + 49 (0) 61 81 / 35-62 91
 Fax + 49 (0) 61 81 / 35-63 11
 E-Mail: sales.git-plr
 @heraeus-quarzglas.com

Ein innovativer Werkstoff für hochwertige Anwendungen

OFM

Opaque Fused Materials

OFM ist ein opakes Quarzglas, das nach einem Lichtbogen-Schmelzverfahren hergestellt wird.

Bedingt durch das Herstellungsverfahren werden vorwiegend rotationssymmetrische Körper, wie Rohre und Tiegel, hergestellt.

Weitere Heißumformprozesse ermöglichen die Herstellung von Platten, Schalen, Blöcke und dünnwandigen Rohren.

Infolge der Lichtstreuung an Feinblasen erscheinen OFM – Teile opak weiß bzw. je nach eingesetztem Rohstoff transluzent

OFM – Qualitäten und Anwendungen



OFM 70 – Rotosil®



wird überwiegend in Prozessen eingesetzt, bei denen hohe Temperaturen erforderlich sind und / oder aggressive Medien zum Einsatz kommen. Weiterhin bieten die spezifischen elektrischen und thermischen Eigenschaften ein breites Anwendungsspektrum.

Anwendungsgebiete:

- Edelmetallrecycling
- Leuchtstoffindustrie
- Hochtemperaturprozesse
- Elektrofilterherstellung
- Chem. Verfahrenstechnik (Behälter, Rohre, Schalen usw.)
- Kalzinier- und Glühprozesse



OFM 370



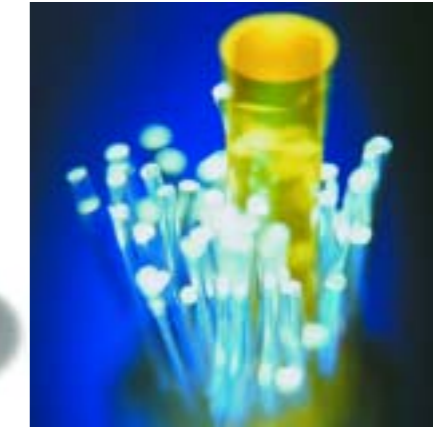
findet Anwendung in Prozessen, bei denen hohe Anforderungen an die Temperatur- und Temperaturwechselbeständigkeit vorliegen. Durch die hohe Reinheit des Rohstoffs, verbunden mit zusätzlichen im Hause befindlichen Aufbereitungsverfahren, erfüllt dieses Produkt alle Anforderungen der Halbleiterindustrie.

Anwendungsgebiete:

- Solarindustrie
- Halbleiterindustrie
- Lichtwellenleiterindustrie
- Glasindustrie



OFM 970



wurde speziell für Hochtemperaturprozesse entwickelt, bei denen hohe thermische Isolationseigenschaften erforderlich sind. Durch die sehr hohe Reinheit wird dieses Material bevorzugt in Reinstprozessen eingesetzt.

Anwendungsgebiete:

- Herstellung optischer Gläser für die Microlithographie
- Halbleiterindustrie
- Lichtwellenleiterindustrie

OFM besitzt eine Reihe von Eigenschaften, die in keinem anderen Werkstoff gleichzeitig so vereint vorkommen:

- extrem niedrige thermische Ausdehnung
- hohe Temperaturwechselbeständigkeit
- hohe Erweichungstemperatur
- geringe Wärmeleitfähigkeit
- hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien
- hohe Beständigkeit gegenüber Schmelzen (z.B. Au, Ag, Si)
- geringe Transmission
- Alle OFM – Qualitäten zeichnen sich im unbearbeiteten Zustand durch eine glasierte, porenfreie und glatte Innenoberfläche aus. Die Außenoberfläche ist nicht glasiert. Diese wird in der mechanischen Bearbeitung geschliffen.
- Eine hochentwickelte Schweißtechnik ermöglicht die Verbindung von unterschiedlichen Qualitäten, unter anderem auch mit transparentem Quarzglas.

Technische Daten: Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte den Produktdatenblätter oder unserer Website <http://www.heraeus.quarzglas.com/ofm>

OFM 70-Chemisches Verhalten

Die Symbole in der Tabelle haben folgende Bedeutung:

- Das Element oder der Bestandteil reagiert nicht mit OFM 70
- ◐ Es reagiert nur über der angegebenen Temperatur
- ◑ Nur die Schmelze der Bestandteile reagiert mit OFM 70
- Das Element oder der Bestandteil reagiert mit OFM 70

Elemente	
○ Ag	
◐ Al	sofortige Reaktion 700 - 800 °C
○ Au	
○ Br	
◐ C	nur über 1.500 °C
◐ Ca	nur über 600 °C
○ Cd	
◐ Ce	nur über 800 °C
○ Cl	ebenso mit Wärme und Feuchtigkeit keine Reaktion
● F	nur in feuchtem Zustand
○ Hg	
○ J	
● Li	nur über 250 °C
◐ Mg	sofortige Reaktion 700 - 800 °C
○ Mn	
○ Mo	
○ Na	reagiert nur im verdampften Zustand
● P	
○ Pb	
○ Pt	
◐ S	sehr träge Reaktion über 700 - 800 °C
◑ Si	
○ Sn	
○ Ti	
○ W	
○ Zn	